電子ビーム真空蒸発装置における 溶融金属液レベルモニタの開発

Development of Molten Metal Level Monitoring system for Electron Beam Heat Vapor Deposition Equipment

技	術	本	部	若	元	郁	夫*1	玉	光		智 *2
				手	島	和	範*3				
神	戸道	生船	所	金	Щ	昭	宏*'	福	囲	信	幸 *4

各種材料に高融点金属を蒸着するための真空蒸着装置では、真空中でるつぼ内の処理対象金属を電子ビーム加熱により溶解・ 蒸発させる.蒸発特性の安定化や長時間運転のためには、るつぼ内溶融金属の液レベルを検出して原料を補給し、これを一定に 保つ必要がある.このような目的に沿って、X線ピンホールカメラを検出器とするるつぼ液レベルモニタを開発した.原理は2 台のX線ピンホールカメラを利用して、電子ビーム照射位置から発生するX線を2方向から検出して三角測量を行うものである. 本モニタにより約±1 mmの精度で液レベルのリアルタイム測定が可能となり、先に開発した電子ビームプロファイルモニタ装置 と合せて、真空蒸着装置の運転制御性が飛躍的に向上した.

In the vacuum evaporating equipment which is used to deposit a high melting point metal on various materials, the metal in the crucible is heated by an electron beam gun. In order to evaporate the metal stably, the surface of the molten metal needs to be controlled to a constant level by feeding the raw material to the crucible. It is necessary for this purpose to detect the level position precisely by any method. We have developed a level monitoring system composed of two X-ray pin hole cameras based on triangular measurement. The camera detects the X-rays generated by the electron beam irradiation on the metal surface. This system ensures the level position for an accuracy within ± 1 mm. The controllability of the vacuum evaporating equipment will be improved by this monitor.

1. まえがき

近年,フィルムや鋼板の表面に高融点金属を蒸着し,機能向上 を図ることが行われている。そこでは金属蒸気を発生させるため の熱源として電子銃が用いられ,長尺のるつぼ中の金属を高温に 加熱する。

これらの装置では所定の位置に電子ビームを照射し,なおかつ 所定の入熱を与える必要がある.

そのため当社では、X線照射部から発生するX線を用いて電子 ビームの照射位置や形状が蒸着膜を介しても監視できるX線カメ ラを開発した⁽¹⁾. さらに、金属蒸発に伴って減少するるつぼ内金属 を一定レベルに保つことによって蒸着装置としての安定性向上が 望まれた.

これを受けて本研究では X 線カメラを2 台用いて,2 方向から 同時に電子ビーム照射位置を検出することにより,三角測量の原 理で溶融金属レベルを測定するシステムを開発した⁽²⁾. 従来は,窓 ガラスを通して目視により液レベルの増減を監視し,レベルが不 足すれば原料金属を供給するという手法であったため,窓ガラス への蒸着などの問題もあり長時間の監視も困難であった.

この X 線カメラによる三角測量法は,電子ビームの軌道が不確 かな場合や外乱の影響で所定の照射位置から外れた場合でも安定 したレベル監視ができ,また長時間連続監視ができるのが特徴で ある.

なお、従来から連続鋳造装置で利用されてきた X 線式レベル計 は、るつぼを挟んだ両端に X 線源とラインセンサを配置して液体 部分を投影するものであり、るつぼのサイズや材質の制約が厳し く、本研究のものとは原理的に異なる.

2. X線カメラの概要⁽³⁾

本研究で使用したカメラは X 線源自身の画像を得るために、ピンホール(厚さ1mmの鉛板に直径0.1~0.5mmの穴をあけたもの)による光学系を用いている.図1にその結像概念図を示す. 電子ビームを金属面に照射すると、照射面は電流密度分布に対応した強度分布を持つ X 線光源となる.そこから発する X 線はピンホールによって X 線画像の検出器有感面に結像される.このとき X 線は可視光とは異なり、蒸着膜や Be 窓を透過して真空容器外側 に導くことができる.X線有感面は二次元電子増倍素子であるマ



イクロチャネルプレート(以下, MCPと称す)に CsI などをコー ティングしたもので, MCP 2枚で最大 10⁶の利得が得られる.

その MCP は小型の真空容器中に封じ込めてあり,増倍した電子 が蛍光面で可視光に変換され,光ファイバを介して真空容器外の CCD 素子に導かれビデオ信号として出力される.図2に X 線カメ ラ2 台を蒸着装置に取付けた状況を示す.X 線カメラ全体の構成 は図2に示すような X 線遮へい性能を有するケースの中に MCP を 内蔵した X 線検出器とピンホール光学系から成る.ピンホールは 外部から操作して移動できる構造になっており,有感面に結像す る像の大きさを変化させることが可能である.



図2 X線カメラの取付け状況 空蒸着試験装置の上部に設置されている. Attaching situation of two X-ray cameras

3. レベル検出原理

3.1 座標系の設定

図3に液レベル算出に関する測定原理説明図を示す.

るつぼ液面が初期レベルのとき、その液面を基準とする。そして、電子ビーム照射形状の重心点を原点とした XYZ 座標系を設定する。つぎに、両カメラの光軸が X-Z 平面内に入り、かつ受光面上の X'軸が基準座標上の Y 軸と平行になるようにそれぞれの X 線カメラを設置したとする。また、このときの X 線カメラの取付け角度は基準座標 Z 軸からの傾斜角度とし、それぞれ θ で示す。

図3に示す測定るつぼ液面のように液レベルが変化すると,電子ビーム照射位置から発するX線の結像位置は両カメラの受光面上において,図に示すように移動する.したがって,受光面上の X'Y'座標上の重心DはそれぞれY'軸方向に移動する.

レベルを計算するためには,まず,受光面上の X'Y'座標系を基 準座標に座標変換する必要がある.その変換式はつぎのとおりで ある.

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \cos\theta \\ -1 & 0 \\ 0 & -\sin\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} + (L_1 + L_2) \begin{bmatrix} \sin\theta \\ 0 \\ \cos\theta \end{bmatrix}$$
(1)

ここで,

また, ピンホール座標 (X_P, Y_P, Z_P)は XYZ 基準座標では, 次式で表せる.



図3 液レベル測定原理図 2 台の X 線カメラ受光面に、 ピンホールを 通過した X 線が結像すると三角測量の原理で X 線発生位置が特定でき る.

Explanation drawing of level measuring system

 $X_{\rm P} = L_2 \sin\theta \tag{2}$

$$Y_{\mathbf{P}} = 0 \tag{3}$$

$$Z_{\rm P} = L_2 \cos\theta \tag{4}$$

3.2 液レベルの算出

図3に示した X線カメラ受光面上において結像した画像の重心 座標をそれぞれ D_1 , D_2 とし, ピンホールの座標を P_1 , P_2 とす る. すると直線 D_1P_1 (測定線 1) と直線 D_2P_2 (測定線 2) は元 来同一の X線発生源から直進した X線の道筋を示しているから, 理想的には両直線は交点があるはずである. したがって, 交点は 測定する液面上にある電子ビーム照射形状の重心位置を示すと同 時に, 交点の Z 座標が測定液レベル H を示す. ただし, 現実的に は X線カメラの設置誤差などの影響から完全なる交点は存在しな い. よって, 2本の測定線 D_1P_1 と D_2P_2 の最も接近した位置を交 点として求めることとした. なお,以下に示す式の座標系はすべ て (XYZ) 座標系である.

測定線1,2はそれぞれ次式で表される.

$$\frac{X - X_{P1}}{X_1 - X_{P1}} = \frac{Y}{Y_1} = \frac{Z - Z_{P1}}{Z_1 - Z_{P1}} = k$$
(5)

$$\frac{X - X_{P2}}{X_2 - X_{P1}} = \frac{Y}{Y_2} = \frac{Z - Z_{P2}}{Z_2 - Z_{P1}} = h$$
(6)

ここで,

 (X_1, Y_1, Z_1) : D_1 点の座標

 (X_2, Y_2, Z_2) : D_2 点の座標

 $(X_{Pl}, 0, Z_{Pl})$: ピンホール1の座標

 $(X_{P2}, 0, Z_{P2})$: ピンホール2の座標

さらに測定線同士が最も接近する座標がそれぞれ存在し、その Z座標を Z_{1e}, Z_{2e} とすると、求めたいレベル H はその平均値で表 し、以下のようになる。

$$H = (Z_{1e} + Z_{2e}) / 2$$
(7)
 $Z = C^{*},$



図4 試験装置及びシステム構成 装置は2台のX線カメラの光軸を、るつぼ液面上の中心に合せてある。2台のX線カメラからの画像情報が同時に画像処理 装置に導かれ、X線画像の重心検出が行われる、パーソナルコンピュータは液レベル演算処理を行う。 Schematic view of test equipment and block diagram of level monitoring system

 $Z_{1e} = Z_{P1} + k (Z_1 - Z_{P1})$ $Z_{2e} = Z_{P2} + h (Z_2 - Z_{P2})$

4. 性能評価結果

4.1 試験装置

図4(a)にX線カメラを設置した試験装置構成の例を示す.

半径約1mの真空容器内中央に蒸発対象金属を満たしたるつぼ を設置し、電子銃は真空容器天井からるつぼ中心をねらっている. また、2台のX線カメラは電子銃を挟んで左右に分かれて設置し ており、両カメラ共るつぼ中心に光軸が合せてある。この状態で 電子ビームをるつぼ中心に照射して金属蒸気を発生させると、金 属蒸気はBe製X線窓を蒸着させてしまう恐れがある。したがっ て、保護のためのグラファイト製の蒸着板で金属蒸気を遮るよう に配慮されている。なお、図4に示した電子銃の姿勢や設置位置 にはほとんど制限はない。磁界を利用して電子ビームがるつぼに 到達するように配慮すればよい。

4.2 システム構成

図4(b)にシステム構成を示す.

2 台ある X 線カメラはそれぞれ No.1, No.2 と呼び, それぞれ のカメラの作動に必要な CCD 用電源と MCP への印加電圧調整用 の電源が接続されている。そして,両カメラの映像信号は1台の 画像処理装置にリアルタイムで導かれる。さらにパーソナルコン ピュータにより,画像処理装置をコントロールして画像処理デー タを用いてレベル演算処理を行う。なお, X 線画像は50 回積算し たものを処理し,測定に要する時間は約1min であった。

4.3 基礎試験

図5(a)に基礎試験時に X線カメラで捕えた電子ビーム像を示し、図5(b)に重心座標検出に至る画像処理方法の説明を示す.

3.1節で説明したとおり、X線カメラは、画面 X'軸がリニア状 の電子ビーム像に対して平行に写るように設置してある。したが って、画像の重心座標を求めるための画像処理は、X'軸方向に積 分した X線強度分布を得ることで容易に求まる。すなわち、電子 ビーム像の Y'方向重心位置は、X線強度分布に適切なしきい値で 区切られた範囲内の重心演算で得られる。こうした手法で得られ た X'Y'座標上での重心座標を式(1)に従って座標変換して、式(7) に代入して液レベル H が求まる。

基礎試験では検出精度を確認するため,るつぼの代りに上下に



(a)X線カメラが捕えた画像



図5 X線カメラが捕えた画像及び画像処理方法 走査電子ビームの照射形状がリニア状に映し出されている。中央の十字線はX線カメラの 光軸中心を示している。X'軸方向にリニア画像を積算処理してX線強度分布を求める。 Example of picture taken by one X-ray camera and image processing

20μmの精度で昇降できる台を設置し、その上に融点の高いタング ステン板を乗せて模擬的な液面を用意した。

図6に検出精度の確認試験結果を示す。

横軸は昇降台の設定レベルを示しており,縦軸は表示されたレベルを示している。それぞれの点は同一レベルで10回づつ測定した平均値を示している。図に示されているとおり,両レベルは良い一致を示している。



4.4 蒸発試験結果

図7に連続的に測定した液レベルの推移を示す.時刻が経過す るにつれて,蒸発に伴ったレベルの減少が確認できる。例えば, 0 min から 18 min ころまでに約2 mm 程度減少している.また, 下向きの矢印は原料を供給した時刻を示している.原料はペレッ ト状のものを使用している.それぞれの原料供給個数は1 個であ り,1 個のペレットの体積と溶融域の面積から換算して約1 mmの 液レベルの上昇が見込まれる.図中の原料供給前後に見られる液 レベルの上昇も平均して1 mm 程度上昇しており,見込みどおり の結果を得たものと評価される.



図7 液レベルの推移 原料供給前後で1 mm のレベル上昇が確認で きる. Example of transiting level

4.5 測定誤差評価

表1に液レベルの測定誤差評価結果を示す. 誤差の要因として は以下の3点が挙げられる.

(1) 光学パラメータの誤差

X線カメラの据付けや組立から加算される寸法誤差について は、真空容器等に JIS B0408 C級の公差が適用されるものと し、角度誤差はこの公差から算出した値である。表1中に示し た光学パラメータ誤差はこうした公差から決定した。

また,液レベル誤差は,液レベル計算式に代入した寸法や角度に対して,それぞれ独立に光学パラメータを加えたときに求まる液レベルの変動分である.誤差の加算は2乗平均加算で行い,両方のカメラ共,それぞれ0.3 mmの誤差が見込まれる.

(2) 位置検出誤差

MCP で X 線を電子に変換し、CCD に画像情報を伝える間に 加わる誤差である.これは受光面上の1 画素分に相当する.こ れも上記と同様に1 画素分の検出位置誤差をレベル計算式に代

表1	液レベルの測定誤差評価結果
	Total accuracy of level monitoring system

	No.1 X 線カメラ					No.2 X 線カメラ				
①光学パラメータ誤差による誤差		光学パラメータ 誤差		液レベル誤差			光学	ペラメータ 誤差	液レベル誤差	
	L_{11}	2.5 mm		0.2 mm		L_{21}	2.5 mm		0.2 mm	
	L ₁₂	6 mm		0.1 mm		L ₂₂	6 mm		0.1 mm	
	θ_1	1°		0.1 mm		θ_2	1°		0.1 mm	
	計			0.3 mm		計			0.3 mm	
②位置検出誤差			画素誤差	液レベル誤差				画素誤差	液レベル誤差	
	X ₁ '方向		1 画素	0 mm		X₂'方向		1 画素	0 mm	
	Y _i '方向		1 画素	0.4 mm		Y2'方向		1 画素	0.3 mm	
		1		0.4 mm		計			0.3 mm	
③ X 線の統計的ばらつきによ る液レベル誤差				0.3 mm (積算回数 50 回)						
液レベル	④系統	充誤差	(①)		0.4 mm					
	⑤偶然誤差(ばらつき誤差) (②, ③)				0.6 mm					
	総合誤差 (④,⑤)				0.7 mm					

入した. 結果は No.1カメラで0.4 mm, No.2カメラで0.3 mm の誤差となった. 両者のカメラで誤差が異なるのは X 線カメラ の取付け状態が異なり, 若干の光学パラメータの違いから生じ ている.

(3) X線の統計的ばらつきによる誤差

到達する X 線は,瞬間的にはランダムなため画像重心は一定 値を取らずばらつきが生じる.基礎試験時に得た,データのば らつきは 0.3 mm であり,画像の積算回数が各カメラごとに 50 回になるのが最適の条件あった.

以上(1)~(3)を総合すると次のようになる.

まず, 系統誤差は光学パラメータ誤差から求まり, 両 X 線カメ ラ分の二乗平均値は約0.4 mm である. つぎに, 偶然誤差は位置 検出誤差とばらつき誤差の二乗平均で求まり, 0.6 mm となる. し たがって, 総合誤差は系統誤差と偶然誤差の二乗平均で求めると 0.7 mm 程度となる. 以上の結果から, 液レベルの測定は約±1 mm 以下の精度で計測できるものと考えられる.

5.まとめ

るつぼ液レベルを測定する目的で,液面上の電子ビーム照射位 置から発生する X 線を,2 台の X 線カメラによって三角測量する 液レベル測定装置を開発し,以下の結果を得た.

- (1) 液レベルの計測サイクルは1回当り約1min である.
- (2) 液レベルの測定誤差は±1 mm 以内である.
- (3) 金属蒸発試験において,原料供給によってほぼ予想される液 レベルまで回復でき,運転の制御性向上の役割を果した.

今後原料供給の自動化や溶融金属表面の元素分布計測機能を有 する X 線カメラを組込んだ,高性能型真空蒸着装置の開発を行う 予定である.

参考文献

- (1)若元郁夫ほか,超高感度X線カメラの開発,第39回応用物 理学関係連合講演会予稿集 2 冊分 30 a-SNC-25 (1992) p.563
- (2) 寺田正文ほか、X線ピンホールカメラを用いたるつぼ液レベルモニタの開発、日本原子力学会1995年秋の大会予稿集 II-9
- (3) 若元郁夫ほか,電子ビームプロファイルモニタ装置の開発, 三菱重工技報 Vol.30 No.4 (1993-7) p.329